【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公表番号】特表2001-510434(P2001-510434A)
【公表日】平成13年7月31日(2001.7.31)
【出願番号】特願平10-533687
【国際特許分類第７版】
　Ｃ３０Ｂ　15/10
【ＦＩ】
　Ｃ３０Ｂ　15/10

【手続補正書】
【提出日】平成16年9月15日(2004.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】補正の内容のとおり
【補正方法】変更
【補正の内容】

手続補正書

平成１６年9月15 日

特許庁長官　　小川　洋　　殿

１．事件の表示

平成１０年特許願第５３３６８７号

２．補正をする者

事件との関係　　特許出願人

名称　ドイチエ・ソーラー・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクテル・ハフツング

３．代　理　人

〒107-0052

住所　東京都港区赤坂１丁目９番１５号

日　本　自　転　車　会　館

氏名(6078)弁理士　小田島　平　吉

電話　３５８５－２２５６

４．補正命令の日付　　なし

５．補正の対象

請求の範囲

６．補正の内容

１）　請求の範囲を別紙の如く訂正する。

以上

特許庁
16. 9. 15
出願支援課
窓口

（別紙）

「 請 求 の 範 囲

１．溶融ポットと固化しつつある非鉄溶融物との接触の後溶融ポットと非鉄金属との接着を回避するために窒化ケイ素保護層を備えた石英、グラファイト又はセラミック溶融ポットであって、該層は、０．３重量％乃至５重量％の酸素含有率を有しそして長さ（１）対直径（ｄ）比が＜１０である窒化ケイ素粉末を含んで成ることを特徴とする溶融ポット。

２．該溶融ポットは、各場合に１０００ｐｐｍ以下のアルカリ金属含有率及びアルカリ土類金属含有率、２０００ｐｐｍ以下のフッ化物含有率、２０００ｐｐｍ以下の塩化物含有率、２０００ｐｐｍ以下の全炭素含有率及び、各場合に、窒化ケイ素粉末１ｇ当たり１００粒子以下の鉄、クロム、コバルト、ニッケル、タングステン及び／又はチタン含有率を有することを特徴とする請求の範囲１に記載の窒化ケイ素保護層を備えた溶融ポット。

３．窒化ケイ素粉末の平均粒子径が５０μｍ以下であることを特徴とする請求の範囲１又は２に記載の窒化ケイ素保護層を備えた溶融ポット。

４．窒化ケイ素粉末の２乃至１００％が結晶学的β相から成ることを特徴とする請求の範囲１～３の１つ又は１つより多くに記載の窒化ケイ素保護層を備えた溶融ポット。

５．窒化ケイ素粉末が無定形であることを特徴とする請求の範囲１～３の１つ又は１つより多くに記載の窒化ケイ素保護層を備えた溶融ポット。

６．窒化ケイ素粉末を溶媒に分散させ、次いで、懸濁液、スリップの

又は粉末としての、ブラッシング、噴霧、噴出、浸漬により、又は静電塗布により基材に塗布し、次いで乾燥することを特徴とする請求の範囲１～５の１つ又はそれより多くに記載の窒化ケイ素保護層を溶融ポットに適用する方法。

７．液体シリコンを保持しそして液体シリコンを結晶化させてシリコンブロック、ロッド又はビレット及びシリコンウエーハ又はシリコングラニュールを形成するための、シリコン溶融物の製造のための請求の範囲１～５の１つ又はそれより多くに記載の窒化ケイ素保護層を備えた溶融ポットの使用。」

以上